

### HOSO+X(X=F, Cl, Br) 的反应机理及电子密度拓扑分析

刘群, 孟令鹏, 郑世钧, 李晓艳\*

河北师范大学化学与材料科学学院, 石家庄 050016

### Mechanism and topological analysis of the electron density of HOSO+X(X=F, Cl, Br) reactions

LIU Qun, MENG LingPeng, ZHENG ShiJun, LI XiaoYan

College of Chemistry and Material Science, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050016, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org